



① Veröffentlichungsnummer: 0 535 540 A3

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **92116389.5**

(51) Int. Cl.5: **C23F** 4/00, H01L 21/321

2 Anmeldetag: 24.09.92

(12)

Priorität: 02.10.91 DE 4132838

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 07.04.93 Patentblatt 93/14

Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB IT

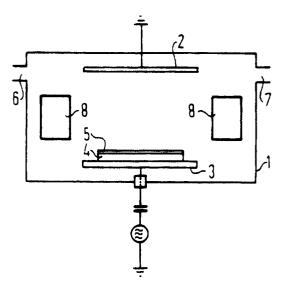
Veröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 19.10.94 Patentblatt 94/42 71 Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München (DE)

2 Erfinder: Grewal, Virinder, Dr. 9 Laurel Court Fishkill, N.Y. 12524 (US) Erfinder: Schwarzl, Siegfried, Dr.

Josef-Kyreinstrasse 11b W-8011 Neubiberg (DE)

(54) Verfahren zum Ätzen einer Al-haltigen Schicht.

 $\[\]$ Eine Al-haltige Schicht (5) wird in einer Reaktionskammer (1) einem Plasma ausgesetzt. Das Plasma wird aus einem Gasgemisch, das HCl-Gas und N₂-Gas enthält, gebildet. In der Reaktionskammer (1) herrscht ein Druck von mindestens 6,67 Pa (50 mTorr).





EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 92 11 6389

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE				
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit der maßgeblichen Tei		Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
A	DE-A-39 40 083 (SIEMENS	AG)	1,2,4-7,	C23F4/00 H01L21/321
	* das ganze Dokument *	-		
A	FR-A-2 312 114 (INTERNA MACHINES CORPORATION) * Seite 1, Zeile 1 - Se Ansprüche 7-13 * * Seite 12, Zeile 28 - S	ite 10, Zeile 38;	1,2,5, 7-9	
D	& US-A-3 994 793 (J. M. AL.)	HARVILCHUCK ET		
A	DE-A-41 05 103 (MITSUBI: * das ganze Dokument *	- SHI DENKI K.K.)	1,3-6,9	
A	EP-A-O 427 327 (N. V. Pi GLOEILAMPENFABRIEKEN) * das ganze Dokument *	HILIPS	1,5,6	
A	EP-A-O 076 860 (HITACHI * das ganze Dokument *	LTD.)	1,2,5,9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5) C23F H01L
Der vo	orliegende Recherchenbericht wurde für al	le Patentansprüche erstellt		
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Präfer

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

- X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet
 Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
 A: technologischer Hintergrund
 O: nichtschriftliche Offenbarung
 P: Zwischenliteratur

- 1: der Ertindung zugrunde liegende I heorien oder Gr
 E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
 D: in der Anmeldung angeführtes Dokument
 L: aus andern Gründen angeführtes Dokument
- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument